



中华人民共和国国家标准

GB/T 14146—93

硅外延层载流子浓度测定 汞探针电容-电压法

**Silicon epitaxial layers—Determination of carrier concentration—
Mercury probe
Voltage-capacitance method**

1993-02-06发布

1993-10-01实施

国家技术监督局发布

中华人民共和国国家标准

硅外延层载流子浓度测定 汞探针电容-电压法

GB/T 14146—93

Silicon epitaxial layers—Determination of carrier concentration—

Mercury probe

Voltage-capacitance method

1 主题内容与适用范围

本标准规定了硅外延层载流子浓度汞探针电容-电压测量方法。

本标准适用于同质的硅外延层载流子浓度测量。测量范围为 $10^{13} \sim 10^{18} \text{ cm}^{-3}$ 。

2 方法原理

汞探针与硅外延片表面接触,形成一个肖特基势垒。在汞探针与硅外延片之间加一反向偏压,结的势垒宽度向外延层中扩展。结的势垒电容(C)及其随电压(V)的变化率(dc/dv)与势垒扩展宽度(x)和其相应的载流子浓度($N(x)$)有如下关系:

$$N(x) = \frac{C^3}{e\epsilon_0\epsilon A^2} \cdot \frac{1}{\left(-\frac{dc}{dv}\right)} \quad \dots \dots \dots \quad (1)$$

式中: x ——势垒扩展宽度, μm ;

$N(x)$ ——载流子浓度, cm^{-3} ;

e —— 电子电荷, 1.602×10^{-19} , C;

ϵ — 硅的相对介电常数, 其值为 11.75;

ϵ_0 — 真空介电常数, 其值为 8.859×10^{-14} , F/cm;

A —— 汞-硅接触面积, cm^2 。

只要测得 C 、 dc/dv 和 A ，便可由式(1)和式(2)计算得到势垒扩展宽度 x 处的 $N(x)$ 。

3 试剂与材料

- 3.1 氢氟酸(ρ 1.15 g/mL), 化学纯。
 - 3.2 硝酸(ρ 1.45 g/mL), 化学纯。
 - 3.3 去离子水, 电阻率大于 2 M Ω · cm(25℃)。
 - 3.4 汞, 纯度大于 99.99%。
 - 3.5 氮气, 纯度大于 99.5%。